PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-254055

(43)Date of publication of application: 13.11.1991

(51)Int.Ci.

H01J 37/20

(21)Application number: 02-049304

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

02.03.1990

(72)Inventor: HOSOI NORIFUNE

MISAWA YUTAKA

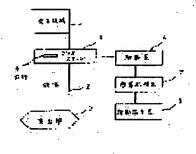
КІМОТО КОЈІ

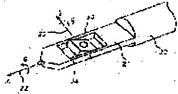
(54) ELECTRON MICROSCOPE

(57)Abstract:

PURPOSE: To accomplish wide range combinations of parallel motion amount with inclining motion amount by calculating the maximum possible motion amount from the situation of other motion amount when a certain specified motion amount is to be varied relative to the parallel motion and inclining motion of a gonio-stage, and thereupon admitting a movement within the limit thus obtained.

CONSTITUTION: A drive command system 8 receives externally a command about parallel motion or inclining motion to be made by a gonio-stage 5, and sends the command to a computational processing system 7. This processing system 7 stores in memory the parallel motion amount and inclining motion amount of the gonio-stage 5 at the current time. When a motion command is received from the drive command system 8, the processing system calculates the limit value for movability and transmits only motion commands within this limit to a drive system 6, which implements the





commands. This allows setting of the motion limit while correlation between the x, y parallel motion and \blacksquare , \blacksquare inclining motion are taken into consideration, so that any desired combination of the x, y, \blacksquare , \blacksquare motion amounts can be achieved within the extent in which the gonio-stage does not touch an objective stop.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−254055

⑤Int.Cl.⁵

識別記号:

庁内整理番号

49公開 平成3年(1991)11月13日

H 01 J 37/20

C 9069-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

の発明の名称 電子顕微鏡

②特 願 平2-49304

②出 願 平2(1990)3月2日

⑩発明者 細井 紀舟

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

@発明者三沢 豊

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

⑩発 明 者 木 本 浩 司

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

勿出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地

四代 理 人 弁理士 小川 勝男 タ

外2名

明 細 書

1. 発明の名称

電子顕微鏡

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は試料に電子線を透過させて、結晶構造、 組成、化学結合状態などの情報を得る電子顕微鏡 及びその類似装置に関する。

〔従来の技術〕

電子線が試料を透過する際に発生する特性又線 を利用しての分析機能を持たせた電子顕微鏡では、 電子線の通路に試料を保持する方法としてサイド エントリー式のゴニオステージを用いるのが一般 的である。ゴニオステージに装着された試料は対 物レンズのポールピースと呼ばれるギヤツブ形成 部のほぼ中央に保持される。第2回はこの様子を 説明するためのゴニオステージ挿入方向から見た 断面図である。対物レンズのポールピースの一部。 分である11,12によつて形成される隙間13 の中央にゴニオステージの試料保持部14が挿入 されている。隙間13内にはこの他に対物絞り 15も挿入されている。電子線16に対する試料 の位置や向きは14の位置や向きを変えて変化さ せることができる。一例として14を傾けた場合、 傾きが大きすぎると14′に示したゴニオステー ジの傾き状態で14と15が接触し、対物絞りが、 破損する。このためゴニオステージの移動可能範

囲を設定して、鏡体内部品との接触を防ぐ必要が

第3回はサイドエントリー方式ゴニオステージ の構造と、並進及び傾斜の機構を説明する図であ る。主軸20の先端付近は平たん部21になつて おり、主軸の中心線方向に×軸22を設定する。 21には×軸22と垂直なy軸23を中心に回転 できる傾斜子24が付いており、試料25は24 に装着される。主韓20の微動によつて試料25 にx方向及びy方向の並進移動を与えることがで き、主軸20の回軸により×軸回りの傾斜8を与 えることができ、傾斜子24の傾斜によりy軸回 りの傾斜 4 を与えることができる。なお、 ェッ平 面は常に平たん部21と平行にとるものとする。 すなわちx軸回りの傾斜によってy軸の方向が変 化するものと約束する。

サイドエントリー方式のゴニオステージにおい ては、第3回で説明した機構によつて試料の電子 線に対する位置と向きを変えることによってでき るが、移動の量がある限度を越えると第2図で説

すなわち、走査電子顕微鏡の鏡体内には広い空間 があるので、ゴニオステージの動きと移動干渉部 材の動きを運動させる機構を組み込む余地が十分 にあつた。これに対して透過電子顕微鏡では、細 い棒状のゴニオステージを電子レンズ内に差し込 む機構であり、十分に安定して動作するようなゴ ニオステージと移動干渉部材の運動機構を付属さ せることは非常に困難である。また仮に実現した としても、サイドエントリー方式ゴニオステージ が大がかりなものになるため、外部からの撮動の 影響を受け易くなり、電子顕微鏡本体の性能を指 つてしまう。

そこで、大型化の不都合を回避するために、単 純化応用が考えられる。これは、1個の移動干渉 部材で正確にゴニオステージのすべての動きをモ ニターするのではなく、x, y, θ , φ のそれぞ れに一組ずつの固定及び移動干渉部材を割り当て る方法である。この方法であれば、x, y, θ, 平のそれぞれの駆動部の適当な部位に正、負の移 動限界値に対応する固定干渉部材と、この間を移

明した様な対物絞りの破損を生じる。この対策と して、x,y方向の並進移動量及びθ、φの傾斜 移動量の全てについて限界値を設けて、これを越 えての移動ができないようインターロックをかけ る必要がある。

この種のインターロックの方法として、特開昭 59~146145号に記載の干渉部材による接触の危険 の検出法が考案されている。これは、鉄体試料室 内部構造を代表する固定干渉部材とゴニオステー ジの移動量を代表する移動干渉部材を設け、移動 干渉部材の移動をゴニオステージの移動と完全に 進動させ、固定干渉部材と移動干渉部材の電気的 なたは機械的接触によつてゴニオステージの移動 限界を検出してインターロツクをかける方法であ

(発明が解決しようとする課題)

上記従来技術は反射電子を検出する走査電子顕 微鏡への利用を想定して考案されたもので、透過 電子を検出する電子顕微鏡のような非常に篩られ た空間での実用化については配慮されていない。

動するような移動干渉部材を設置すれば良く、大 型化の大都合は生じない。しかし、この場合、x。 γ, θ, Ψのそれぞれについて個別に固定された 限界値を設けるため、x、y、θ、φの全てが同 時に限界値となつてもゴニオステージと対物校り の接触が生じない範囲でなければならないという 欠点がある。

近年の電子顕微館に対する高分解能化の要求の ために、上記従来技術の単純化応用インターロツ クの欠点が顕著なものとなつてきた。

分解能は電子線の波長が短いほど向上し、また、 対物レンズの磁界が強いほど向上する。対物レン ズの磁界を強めるにはポールピースの隙間を狭く する必要があり、その分だけゴニオステージの移 動量の範囲が小さくなり、電子線の加速電圧300 kVクラスの電子顕微鏡では波長が短いので高分 解能化によつてもポールピースの隙間はさして狭 まらないが、200kVクラスでは隙間の狭まり の影響が大きい。従来の限界値設定方法では、分 解館 1.4 nm の装置ではx, yが土 1 mm、8。

 φ が± 2 0 ° の範囲で移動できたが、 $1 \cdot 0$ n m 分解能装置では、 \mathbf{x} , \mathbf{y} が± 1 \mathbf{m} 、 $\boldsymbol{\theta}$, φ が± 1 0 ° の範囲に制約される。

一例として、 $1.0~\rm nm$ 分解能装置において試料の移動量を $x=y=0.5~\rm nm$, $\theta=2.0~\rm nm$, $\phi=5~\rm nm$, $\theta=2.0~\rm nm$, $\phi=5~\rm nm$, $\phi=5~\rm nm$, $\phi=5~\rm nm$, $\phi=5~\rm nm$, $\phi=1.0~\rm nm$, $\phi=1.0$

本発明の目的は、従来の干渉部材の接触法には 依らずに、x,y, θ, ೪の各々の移動量につい て相対的に考慮しながら動作するインターロック 手段を備えることにより、ゴニオステージと対物 较りの接触が生じない範囲での自由なx,y, θ, ೪の組合せを実現する電子顕微鏡を提供すること にある。特に、本発明の電子顕微鏡は結晶性物質

(実施例)

以下、本発明の一実施例を説明する。第1図は本実施例の基本構造図である。ゴニオステージ5は電子顕微鏡の鏡体2の中の電子線の通路に試料4を保持しており、試料4に対して第3図で示し

の解析に有利である。

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するために、x,y, 8, 4の 移動量のうちのいずれかを変えようとする毎に、 他の移動量を現状の値に保持するという条件下で 変えようとする移動量のみの移動限界値を算出し、 この限界値の範囲内での移動を許す構造とした。 【作用】

第4回及び第5回は本実施例におけるゴニオステージの並進及び傾斜移動の制御方法を説明するために、位置座標系を定義する回及びゴニオステージに設けた座標モニター点を示す回である。第3回に示した並進方向を定義する×軸、y軸とは別に、鏡体内におけるゴニオステージの位置を表すための直交座標系を第4回のように設定する。電子鏡の進行方向31と平行に2軸33をとり、

一般にある座標点を表わす3項数ペクトルロの並、傾斜移動操作による新座標を表わす3項数ペクトルログクトルログの関係は、Aを3行3列の行列として、Aロ=ログと表わされる。この関係を本実施例の座標系に適用すれば、現在のX、Y、2座標と8、

本実施例によれば、ゴニオステージによる競体 内部品の破損を生じることなく、従来の移動制限 方法では実現し得ない範囲の移動量の組み合せを 実現する電子顕微策を提供できる。

〔発明の効果〕

本発明によれば、電子顕微鏡の鏡体内におけるゴニオステージの並進及び傾斜の移動に対して固定された上限値を設けるのではなくて、ある移動量を変える場合に、他の移動量の状況から可能な最大移動量を算出してその範囲の移動を許すので、広い範囲の並進、傾斜移動量の組合せを実現できる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例の基本構成図、第2 図はゴニオステージの試料保持部近くの電子微鏡 鏡質体内部の様子を示す図、第3回はサイドエントリー方式ゴニオステージの構造と並進及び傾斜 の機構の説明図、第4回は本発明の一実施例にお けるゴニオステージの制御のために設けた X Y Z 直交座標系の説明図、第5回は本発明の一実施例 中の下で±x,±y,±8,±φのどの移動操作 ん加えるかによりAは一義的に定まる。また、a は現在の X, Y, Z 座標そのものであるから、 a'=について簡単な代数で解くことができ、こ の Z 座標成分の範図を± | Z a a x | 以下にするよう に制御すれば良い。

本実施例では、演算処理系 7 に、 a \sim h , ϱ \sim o 各点の X , Y , Z 座 標及 U 傾斜角 θ , φ の 値を記憶しておき、さらに並進や傾斜の命令毎に行列計算を実行させ、 a \sim h , ϱ \sim o のすべての Z 座 想が \pm $|Z_{*ax}|$ 以下である 場合に駆動系 7 に ゴニオステージの移動を実行させている。

におけるゴニオステージの制御のために設けた座 標位置モニター点を示す図である。

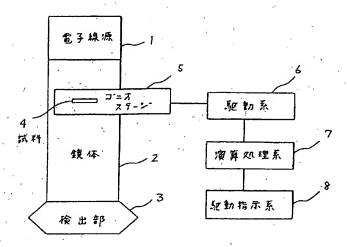
1 …電子線源、2 …電子顕微鏡の鏡体、3 …電子 線の検出部、5 …サイドエントリー方式のゴニオ ステージ、6 …駆動系、7 … 演算処理系、8 …駆 動指示系、11,12 …対物レンズのポールピー スの一部、13 …ポールピースの隙間、14 … ゴ ニオステージの試料保持部、15 …対物紋り、

20 … ゴニオステージの主軸、21 … 主軸先端の 平たん部、22 … x 軸、23 … y 軸、24 … 傾斜 子、25 … 試料。

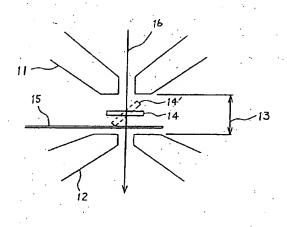
代理人 弁理士 小川勝男



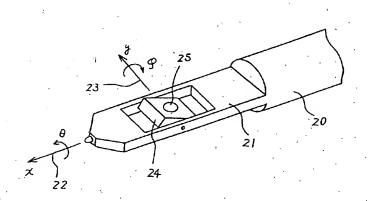
第 1 図



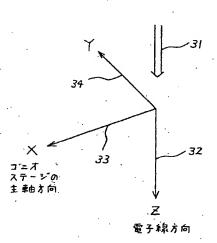
第 2 図



第 3 図



第 4 図



第 5 図

